BUNDES EPUBLIK DEUTS LAND 1 1 03.03



REC'D 0 2 APR 2003
WIPO PCT

DEOX OD51

## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

102 09 191.9

Anmeldetag:

4. März 2002

Anmelder/Inhaber:

Philips Corporate Intellectual Property GmbH,

Hamburg/DE

Bezeichnung:

Vorrichtung zur Erzeugung von UV-Strahlung

IPC:

02/00 EDV-L H 01 J 65/04

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 24. Februar 2003

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

KNUUULUET

PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Waasmaier

#### ZUSAMMENFASSUNG

Vorrichtung zur Erzeugung von UV-Strahlung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung mittels einer Exzimer-Entladung, ausgerüstet mit einem zumindest teilweise UV-transparenten Entladungsgefäß, dessen Entladungsraum mit einer Gasfüllung gefüllt ist, mit Mitteln zur Zündung und Aufrechterhaltung einer Exzimer-Entladung in dem Entladungsraum und mit einer Beschichtung, die einen Leuchtstoff, der ein Wirtsgitter und Neodym(III) als Aktivator umfasst, enthält.

10 Die Erfindung betrifft auch die Verwendung der Vorrichtung für photolytische Prozesse.

Fig. 1.

15

4.MAR.2002 14:28 CIP-DE AACHEN NR.450 S.4/28

PHDE020051

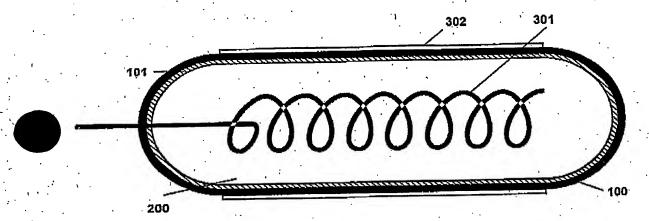


FIG. 1

#### BESCHREIBUNG

Vorrichtung zur Erzeugung von UV-Strahlung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erzeugung elektromagnetischer Strahlung, ausgerüstet mit einem mindestens teilweise transparenten Entladungsgefäß, dessen Entladungsraum mit einer Gasfüllung gefüllt ist, mit Mitteln zur Zündung und Aufrechterhaltung einer Exzimer-Entladung in dem Entladungsraum und mit einer Beschichtung, die einen Leuchtstoff enthält.

Derartige Strahlungsquellen eignen sich, je nach dem Spektrum der emittierten

Strahlung, für die Allgemein- und Hilfsbeleuchtung, z.B. Wohn- und Bürobeleuchtung,
für die Hintergrundbeleuchtung von Anzeigen, z.B. Flüssigkristallanzeigen, für die
Verkehrs- und Signalbeleuchtung und für photochemische Prozesse, z.B. für Entkeimung oder Photolytik.

Es handelt sich dabei insbesondere um Vorrichtungen, wie sie aus EP 1048 620 für die Desinfektion von Wasser bekannt sind.

Ein Nachteil der in EP 1048 620 beschriebenen Vorrichtungen besteht darin, dass der erzielte optische Wirkungsgrad für photolytische Anwendungen gering ist.

In photolytischen Prozessen wird Strahlung sehr hoher Photonenenergie von bestimmten organischen Molekülen absorbiert, wobei z.B. die chemischen C-C- und C-O-Bindungen in den Molekülen aufgespalten werden. Photolytische Prozesse verwendet man z.B. für die Herstellung von hochreinem Wasser, bei der Trockenreinigung von Oberflächen, der Härtung von Polymeren u.ä.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung zur Verfügung zu stellen, die optimal für photolytische Prozesse geeignet ist.

### BEST AVAILABLE COPY

Incredor (13126)

15

2.

PHDE020051

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst durch eine Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung mittels einer Exzimer-Entladung, ausgerüstet mit einem zumindest teilweise UV-transparenten Entladungsgefäß, dessen Entladungsraum mit einer Gasfüllung gefüllt ist, mit Mitteln zur Zündung und Aufrechterhaltung einer Exzimer-Entladung in dem Entladungsraum und mit einer Beschichtung, die einen Leuchtstoff, der ein Wirtsgitter und Neodym(III) als Aktivator umfasst, enthält.

Eine derartige Vorrichtung konvertiert die von der Exzimer-Entladung erzeugte Primärstrahlung in Strahlung mit einem Maximum der Emission bei einer Wellenlänge zwischen 180 und 250 nm. Strahlung mit diesem Wellenlängenbereich hat eine hohe Photonenenergie und bricht auch starke chemische Bindungen wie die C-C bzw. C-O-Einfachbindungen auf. Sie ist daher besonders geeignet zur Verwendung für photolytische Prozesse, wie sie bei der Herstellung von hochreinem Wasser, bei der Trockenreinigung von Oberflächen, der Härtung von Polymeren u.ä. eingesetzt werden.

Das Maximum der Emission liegt also in dem Bereich zwischen 180 und 250 nm, der die photolytischen Reaktionen begünstigt und eine große Eindringtiefe in Wasser und anderen Lösungsmitteln hat.

20 Nach einer Ausführungsform der Erfindung enthält der Leuchtstoff als Koaktivator Praseodym(III).

Es ist bevorzugt, dass der Leuchtstoff ausgewählt ist aus der Gruppe (La<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>) PO<sub>4</sub>:Nd mit  $0 \le x \le 1$ ; (La<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>) PO<sub>4</sub>:Nd,Pr mit  $0 \le x \le 1$ ; SrAl<sub>12</sub>O<sub>19</sub>:Nd; LaBO<sub>3</sub>O<sub>6</sub>:Nd; LaMgB<sub>5</sub>O<sub>10</sub>:Nd; SrAl<sub>12</sub>O<sub>19</sub>:Nd,Pr; LaBO<sub>3</sub>O<sub>6</sub>:Nd,Pr; LaMgB<sub>5</sub>O<sub>10</sub>:Nd,Pr und GdPO<sub>4</sub>:Nd,

Es kann auch bevorzugt sein, dass der Leuchtstoff eine Beschichtung, die ein Oxid, ausgewählt aus der Gruppe MgO, SiO<sub>2</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, enthält, umfasst.

Nach einer Ausführungsform der Erfindung enthält die Gasfüllung ein Gas, ausgewählt aus der Gruppe Xenon, Krypton, Argon und Neon.

Besonders bevorzugt ist es, dass die Gasfüllung Xenon enthält. Eine Xenon-Exzimer-Entladung hat eine besonders effiziente VUV- Erzeugung mit einem Maximum bei 172 ± 3.5 nm, die von den Nd(III)-aktivierten Leuchtstoffen zu mehr als 80 % konvertiert wird.

Die Elektroden können aus einem Metall oder einer Legierung bestehen, das UV-C-Licht reflektiert.

Ein Teil des Entladungsgefäßes kann mit einer Beschichtung versehen werden, die als Reflektor für VUV- und UV-C-Licht wirkt.

Die Erfindung betrifft auch die Verwendung der Vorrichtung für photolytische Prozesse.

- Nachfolgend wird die Erfindung anhand von fünfzehn Figuren und drei Ausführungsbeispielen weiter erläutert.
  - Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform einer Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung mit einer zentrischen Elektrode.
- 20 Fig. 2 zeigt eine erste Ausführungsform einer Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung mit einer zentrischen Elektrode im Querschnitt.
  - Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform einer Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung vom Koaxial-Typ.
  - Fig.4 zeigt eine zweite Ausführungsform einer Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung vom Koaxial-Typ im Querschnitt.
  - Fig. 5 zeigt eine dritte Ausführungsform einer Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung vom Tubulär-Typ.
  - Fig. 6 zeigt eine dritte Ausführungsform einer Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung vom Tubulär-Typ im Querschnitt.

30

25

4.MAR.2002

- Fig. 7 zeigt eine vierte Ausführungsform einer Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung mit vergrabenen Ricktroden.
- Fig. 8 zeigt eine vierte Ausführungsform einer Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung mit vergrabenen Elektroden im Querschnitt.
- Fig. 9 zeigt eine fünfte Ausführungsform einer Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung mit UV-Reflektoren.
  - Fig. 10 zeigt eine fünfte Ausführungsform einer Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung mit UV-Reflektoren im Querschnitt.
  - Fig. 11 zeigt eine sechste Ausführungsform einer Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung durch Korona-Entladung im Querschnitt.
  - Fig. 12 zeigt eine sechste Ausführungsform einer Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung durch Korona-Entladung in Aufsicht.
  - Fig. 13 zeigt eine siebte Ausführungsform einer Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung als Flachlampe.
- 15 Fig. 14 zeigt eine siebte Ausführungsform einer Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung als Flachlampe im Querschnitt.
  - Fig. 15 zeigt in einem Diagramm eine Beispielrechnung zur Effizienz der Erzeugung von UV-Fluoreszenzstrahlung um 200 nm aus der Primärstrahlung einer Xe-Exzimerentladung.

Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung mittels einer Exzimer-Entladung ist mit einem mindestens teilweise UV-transparenten Entladungsgefäß, dessen Entladungsraum mit einer Gasfüllung gefüllt ist, und mit einer Beschichtung, die einen Leuchtstoff, der ein Wirtsgitter und Neodym(III) als Aktivator umfasst, enthält, ausgerüstet. Außerdem ist die Vorrichtung mit Mitteln zur Zündung und Aufrechterhaltung der Exzimer-Entladung ausgerüstet.

Für das Entladungsgefäß ist eine Vielzahl von Bauformen wie Platten, einfache Rohre, Koaxialrohre, gerade, U-förmig, kreisförmig gebogene oder gewendelte, zylinderförmige oder anders geformte Entladungsröhren möglich. Eine typische Bauform für eine

etreff: 28 Seite(n) empfangen

20

25

NR. 450

-5.

Vorrichtung für photolytische Reaktionen ist die Form gemäß Fig. 1 und 2. Als Mittel zur Zündung und Aufrechterhaltung der Exzimer-Entladung umfasst diese Bauform u.a. Elektroden erster und zweiter Art. In dem Gasentladungsgefäß 100 ist konzentrisch ein gewendelter Draht eingeschoben. Dieser bildet die erste, innere Elektrode 301 der Vorrichtung. Das äußere Glas ist mit einem engmaschigen Drahtnetz bedeckt, das die zweite, äußere Elektrode 302 bildet. Das Entladungsgefäß ist gasdicht verschlossen. Der Innenraum ist mit Xenon oder einem Xenon enthaltenden Gas gefüllt. Die beiden Elektroden sind mit beiden Polen einer Wechselstromquelle verbunden. Die Elektrodengeometrie zusammen mit dem Druck im Entladungsgefäß und der Gaszusammensetzung wird auf die Daten der Wechselstromquelle abgestimmt.

Eine andere typische Bauform für photolytische Reaktionen ist die zentral von Wasser oder einem Luftstrom durchflossene Koaxialform gemäß Fig. 3 und 4. Das Entladungsgefäß 100 besteht aus zwei koaxialen Glaskörpern, die gasdicht zu einer Hohlmanschette verbunden sind. Der Ringspalt zwischen den beiden koaxialen Glaskörpern bildet den Entladungsraum 200 und ist mit Xenon oder einem Xenon enthaltendem Gas gefüllt. Das zu behandelnde, fluide Medium kann durch das innere Rohr fließen, an dessen Innenwand eine transparente Elektrode erster Art 301 aufgebracht ist. Das zu behandelnde Medium kann sich auch außerhalb des Außenrohrs befinden. Das äußere Glas ist mit einem engmaschigen Drahtnetz bedeckt, das die äußere, zweite Elektrode 302 bildet. Die Stromversorgung erfolgt durch eine an diese beiden Elektroden angeschlossene Wechselstromquelle.

Eine weitere typische und einfach herzustellende Bauform ist in Fig. 5 und 6 abgebildet.

Die flache Bauform gemäß Fig. 13 und 14 ("Flachlampe") eignet sich besonders zur Trockenreinigung von Oberflächen und zur Lackhärtung.

In der Bauform gemäß Fig. 7 und Fig. 8 sind die Elektroden an der Innenseite der Wandung des Gasentladungsgefäßes angebracht und durch eine Deckschicht aus einem

CIP-DE RACHEN

dielektrischen Material 102 von dem Gasentladungsraum 200 getrennt. Diese dielektrische Deckschicht 102 besteht bevorzugt aus Glaslot.

Als Material für das Entladungsgefäß werden bevorzugt Quarz oder Glassorten verwendet, die für UV-C- und VUV-Strahlung durchlässig sind.

Die Mittel zur Zündung und Aufrechterhaltung einer Exzimer-Entladung umfassen Elektroden erster und zweiter Art. Nach einer bevorzugten Ausführungsform sind zur Erzeugung einer dielektrisch behinderten Entladung auf der Wandung des Entladungsgefäßes Elektroden erster und zweite Art angeordnet, wobei mindestens eine Elektrode durch ein dielektrisches Material vom Entladungsraum getrennt ist. In Bauformen, in denen mindestens eine Elektrode vom Entladungsraum durch eine dielektrische Barriere getrennt ist, wird, wenn eine geeignete Wechselspannung angelegt wird, in dem Füllgas eine stille elektrische Entladung gezündet.

15

25

In Bauformen gemäß Fig. 11 und 12 wird, wenn eine geeignete Gleich- oder Wechselspannung an die Elektroden angelegt wird, in dem Füllgas eine Entladung vom Korona-Typ gezündet. In Bauformen, die für eine Entladung vom Korona-Typ geeignet sind, ist es nicht erforderlich, dass die Elektroden erster und zweiter Art vom Füllgas durch eine Schicht aus einem dielektrischen Material getrennt sind.

Sowohl bei der stillen elektrischen Entladung als auch bei der Korona-Entladung bildet sich bei geeigneter Gasfüllung und abhängig von Gasdruck und Elektrodengeometrie ein Plasma, das Exzimere, d.h. Moleküle, die nur im angeregten Zustand stabil sind, enthält.

Die Elektroden bestehen aus einem Metall, z.B. Aluminium oder Silber, einer Metalllegierung oder aus einer transparenten leitfähigen anorganischen Verbindung, z.B. ITO. Sie können als Beschichtung, als aufgeklebte Folie, als aufgeklebte Folienstreifen, als Draht oder als Drahtnetz ausgebildet sein.

treff: 28 Seite(n) empfangen

Es ist auch möglich, als eine der Elektroden einen transparenten Elektrolyten, z.B. Wasser zu verwenden. Dies ist besonders vorteilhaft für photolytische Prozesse in Wasser, weil auf diese Art und Weise die Strahlung in unmittelbarer Nähe des zu bestrahlenden Mediums gebildet wird.

5

Nach einer anderen bevorzugten Ausführungsform sind zur Erzeugung einer Koronaentladung auf der Wandung des Entladungsgefäßes Elektroden erster und zweiter Art angeordnet.

Um die Lichtstärke in eine bestimmte Richtung zu bündeln, kann ein Teil des Entla-10 dungsgefäßes mit einer Beschichtung versehen werden, die als Reflektor für VUV- und UV-C-Licht 400 wirkt. Bevorzugt werden UV-Reflektoren für Bauformen gemäß Fig. 9 oder Fig. 10 eingesetzt, um die Abstrahlung durch eine Fläche nach innen oder nach außen zu erhöhen.

15

Als Reflektoren für Strahlung im UV-C- oder VUV-Bereich eignen sich metallische Flächen, die gegebenenfalls mit einer UV-transparenten Schutzschicht versehen sind. Beispielsweise ist eine mit Magnesiumfluorid beschichtete Aluminiumfolie geeignet.

20 Eine andere geeignete Ausführungsform für eine Beschichtung, die als Reflektor wirkt, ist eine Beschichtung, die Partikel aus einem Material, ausgewählt aus der Gruppe MgO, SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, (La<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>) PO<sub>4</sub> mit  $0 \le x \le 1$ ; (La<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>) PO<sub>4</sub> mit  $0 \le x \le 1$ ; SrAl<sub>12</sub>O<sub>19</sub>;  $LaB_3O_6; LaMgB_5O_{10}; SrAl_{12}O_{19}; LaBO_3O_6; LaMgB_5O_{10} \ \mathrm{und} \ GdPO_4, \ \mathrm{enthalt.} \ \backslash$ 

Als Reflektor für Strahlung im UV-C- oder VUV-Bereich können auch bestimmte Ausführungsformen der Elektroden erster und zweiter Art wirken, die großflächig sind und aus einem metallischen Material bestehen. Eine derartige Ausführungsform ist beispielsweise in Fig. 11 gezeigt.

30

\_ ጸ.

Das Entladungsgefäß ist bevorzugt mit sauerstofffreiem Xenon oder einem Gasgemisch, das Xenon enthält, gefüllt, weil die Elektronenenergieverteilung einer Exzimer-Entladung in einer Xenon-haltigen Atmosphäre mit wesentlicher Besetzungsdichte im Bereich der ersten Xe-Anregungsenergie von 8.4 eV optimal auf die Bildung von Xe<sup>2</sup>-Exzimeren und durch deren Emission im Wellenlängenbereich zwischen 160 und 190 nm auf die Anregung Neodym-haltiger Leuchtstoffe abgestimmt ist.

Die Innenwand des Entladungsgefäßes ist teilweise oder ganz mit einem Überzug, der den Leuchtstoff enthält 101, beschichtet. Weiterhin kann der Überzug noch ein organisches oder anorganisches Bindemittel oder eine Bindemittelzusammensetzung enthalten. Weiterhin kann die Leuchtstoffschicht noch mit einer Schutzschicht gegen den Angriff der Entladung geschützt werden.

Der Leuchtstoff besteht aus einem Wirtsgitter, das mit einigen Prozent eines Aktivators dotiert ist. Die Nd³+-aktivierten Leuchtstoffe, die gemäß der Erfindung verwendet werden, sind in erster Linie Leuchtstoffe mit einem Wirtsgitter, das ein schwaches Ligandenfeld ausübt. Insbesondere sind die anorganischen sauerstoffhaltigen Wirtsgitter aus Oxiden, Aluminaten, Gallaten, Phosphaten, Boraten oder Silikaten geeignet. Eine hohe Koordinationszahl in diesen Wirtsgittern emiedrigt zusätzlich die Kristallfeldaufspaltung der an den optischen Übergängen beteiligten d-Orbitale des Neodyms. Dadurch liegen die VUV- und UV-C-Strahlung emittierenden 4f5d-Niveaus des Neodyms mit 43000 cm⁻¹ über dem Grundzustand so hoch, dass eine strahlungslose Relaxation über angeregte 4f4f-Zustände vermieden wird. Deshalb sind diese Nd³+-aktivierten Leuchtstoffe, insbesondere die Leuchtstoffe, die ausgewählt sind aus der Gruppe (La<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>) PO₄:Nd mit 0 ≤ x ≤ 1; (La<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>) PO₄:Nd,Pr mit 0 ≤ x ≤ 1; SrAl<sub>12</sub>O<sub>19</sub>:Nd; LaBO<sub>3</sub>O<sub>6</sub>:Nd; LaMgB<sub>5</sub>O<sub>10</sub>:Nd; SrAl<sub>12</sub>O<sub>19</sub>:Nd,Pr; LaB<sub>3</sub>O<sub>6</sub>:Nd,Pr; LaMgB<sub>5</sub>O<sub>10</sub>:Nd,Pr und GdPO₄:Nd besonders effiziente Leuchtstoffe unter Vakuum-UV-Anregung.

Das Nd<sup>3+</sup>-Ion zeigt als Aktivator in den verschiedenen Wirtsgittem meist breite Absorptionsbanden im Ultravioletten, teilweise bis ins Blaue reichend. Die Emissionsbanden der erfindungsgemäßen Leuchtstoffe liegen im Bereich vom tiefen Ultraviolett bis zum

- 9 -

Gelborange, mit einem Emissionsmaximum bei einer Wellenlänge zwischen 180 und 250 nm, also im UV-C- und VUV-Bereich. Die Löschtemperatur dieser Leuchtstoffe liegt bei über 100°C.

Besonders bevorzugt können auch Leuchtstoffe sein, die Praseodym enthalten, wie z.B.
(La<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>) PO<sub>4</sub>:Nd,Pr mit 0 ≤ x ≤ 1; SrAl<sub>12</sub>O<sub>19</sub>:Nd,Pr; LaB<sub>2</sub>O<sub>6</sub>:Nd,Pr; LaMgB<sub>5</sub>O<sub>10</sub>:Nd,Pr.

Wenn eine Wechselspannung an die Elektroden angelegt wird, wird in dem bevorzugt zenonhaltigen Füllgas eine stille elektrische Ladung gezündet werden. Dadurch bilden sich im Plasma Xenon-Exzimere, d. h. Moleküle, die nur im angeregten Zustand stabil sind.

 $Xe + Xe^* = Xe_2^*$ 

10

treff: 28 Seite(n) empfangen

Die Anregungsenergie wird als UV-Strahlung mit einer Wellenlänge von λ = 140 bis
190 nm wieder abgegeben. Diese Umwandlung von Elektronenenergie in UV-Strahlung
erfolgt sehr effizient. Die erzeugten UV-Photonen werden von den Leuchtstoffen absorbiert und die Anregungsenergie wird in dem längerwelligen Bereich des Spektrums
teilweise wieder abgegeben. Der Absorptionskoeffizient der mit Nd³+ oder mit Nd³+ und
Pr³+ aktivierten Leuchtstoffe ist für die Wellenlängen im Bereich der Xenonstrahlung
besonders groß und die Quantenausbeute hoch. Das Wirtsgitter beeinflusst die genaue
Lage der Energieniveaus des Aktivatorions, und infolgedessen das Emissionsspektrum.

Die Herstellung der Leuchtstoffe erfolgt durch eine Festkörperreaktion aus den Ausgangsverbindungen als feinkörnige Pulver mit einer Korngrößenverteilung zwischen 1 und 10 µm. Sie werden auf die Gefäßwände des Entladungsgefäßes mittels eines Flow-Coating-Verfahrens aufgebracht. Die Beschichtungssuspensionen für das Flow-Coating-Verfahren enthalten Wasser oder eine organische Verbindung wie Butylacetat als Lösungsmittel. Die Suspension wird durch Zugabe von Hilfsmitteln, wie Stabilisatoren, Verflüssigern, Cellulosederivaten, stabilisiert und in ihren rheologischen Eigenschaften beeinflusst. Die Leuchtstoffsuspension wird als dünne Schicht auf die Gefäßwände aufgebracht, getrocknet und bei 600°C eingebrannt. Das Gefäß wird dann evakuiert, um

alle gasförmigen Verunreinigungen, insbesondere Sauerstoff, zu entfernen. Anschließend wird das Gefäß mit Xenon mit einem Gasdruck von etwa 200 bis 300 mbar gefüllt und verschlossen.

- Die beschriebenen Vorrichtungen eignen sich gut für photolytische Reaktoren hoher Ausbeute. Da die emittierte Strahlung ein schmalbandiges Spektrum aufweist, kann die erfindungsgemäße Vorrichtung vorteilhafterweise für die Durchführung von wellenlängenselektiven Photoreaktionen verwendet werden.
- 10 Tabelle 1 zeigt Absorptionskanten einiger gängiger Lösungsmittel
  Tabelle 1:

Lösungsmittel	Absorptionskante [nm]
Isopropylalkohol	210
Cyclohexan	210
Methylcyclohexan	210
Ethanol	210
Methanol	210
Acetonitril	210
2,2,4-Trimethylpentan	220
Iso-oktan	220
Hexan	220
Dioxan	220
Glycerol	230
Dichlormethan	235
1,2-Dichlorethan	240
Chloroform .	250

- 11 -

Ferner können technische photochemische Prozesse (z.B. Photochlorierung, Photobromierung, Photosulfochlorierung) mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung effizienter durchgeführt werden.

- Weitere Verwendungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung betreffen die Wasserund Abwassertechnik, bei welchen ein belastetes Wasser das zu behandelnde Fluid ist. Als Beispiele für die Behandlung können genannt werden: a) Entkeimung; b) Abbau von Schadstoffen, Farbstoffen oder Geruch.
- 10 Die erfindungsgemässe Vorrichtung kann auch für die Sterilisierung anderer Flüssigkeiten und Lösemittel verwendet werden.

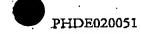
Im Fall der Bauform gemäß Fig. 1 und 2 kann das zu behandelnde Medium an der Außenfläche des Strahlers vorbeigeführt werden. In einer weiteren Anwendung kann diese Bauform z.B. zur Trockenreinigung von Oberflächen eingesetzt werden.

Im Fall der Bauform gemäß Fig. 3 und 4 wird das reagierende Medium an der Innenund/oder Außenfläche des Strahlers vorbeigeführt. Um eine Bestrahlung an der Innenfläche zu ermöglichen, muss die der Lampenachse zugewandte Elektrode transparent oder durchbrochen ausgeführt sein. Diese Bauform kann verwendet werden, um in Wasser oder Luft bzw. in anderen Gasen Reste von Lösungsmitteln zu zerstören.

Wie in Fig. 15 gezeigt, ist bei einer Treibereffizienz von 85%, einer Plasmaeffizienz der Xenon-Exzimer-Entladung von 60%, einer Konversionseffizienz des Leuchtstoffs von 80% sowie einer Transmission des Materials des Gasentladungsgefäßes von 80% eine Gesamt-Effizienz von 25 % erreichbar. Das ist mehr als das Dreifache der Effizienz einer Quecksilber -VUV-Lampe.

30

10



#### AUSFÜHRUNGSBEISPIEL 1

Es wird eine Suspension von LaPO<sub>4</sub>:Nd in Butylacetat mit Nitrocellulose als Binder hergestellt. Mittels eines Flow-Coating-Verfahrens wird die Leuchtstoffsuspension auf die Innenwand eines Rohrs aus synthetischem Quarz (Suprasil<sup>TM</sup>) von 5 mm

Innendurchmesser aufgebracht. Die Dicke der Leuchtstoffschicht entspricht einem Flächengewicht des Leuchtstoffes von 3mg/cm². Der Binder wird bei einer Temperatur unterhalb von 580°C ausgebrannt. Die Vorrichtung wird mit Xenon mit einem Gasdruck von 200 bis 300 mbar gefüllt und dann verschlossen.

Sauerstoffverunreinigungen müssen sorgfältig vermieden werden. Auf der Außenwand der Vorrichtung werden diagonal zwei Elektroden aus Aluminiumfolie aufgeklebt.

Die Vorrichtung wird mit Wechselstrom mit Rechteckcharakteristik mit einer Amplitude von 6 kV und einer Frequenz von 25 kHz betrieben.

. 15

20.

#### AUSFÜHRUNGSBEISPIEL 2

Das Entladungsgefäß der Vorrichtung nach Ausführungsbeispiel 2 besteht aus einem zylindrischen Rohr aus synthetischem Quarz (Suprasil<sup>TM</sup>) von 0.7 mm Dicke und 50 mm Durchmesser. Es ist Xenon mit einem Druck von 200 mbar gefüllt. In der Achse des Rohrs ist eine spiralig gewendelte innere Elektrode aus Metalldraht angeordnet. Auf der Außenwand des Entladungsgefäßes werden sechs Streifen aus Silberfolie parallel zur inneren Elektrode als äußere Elektroden aufgeklebt. Die innere Oberfläche der Außenwandung wird mit einer Leuchtstoffschicht beschichtet, die YPO4:Nd als Leuchtstoff enthält.

25

Die Vorrichtung wird mit Wechselstrom mit Rechteckcharakteristik mit einer Amplitude von 6 kV und einer Frequenz von 25 kHz betrieben.

30

NR. 450

- 13 -

#### AUSFÜHRUNGSBEISPIEL 3

Das Entladungsgefäß der Vorrichtung nach Ausführungsbeispiel 3 besteht aus zwei koaxialen Rohren aus synthetischem Quarz (Suprasil<sup>TM</sup>) von 0.7 mm Dicke und 50 mm Innendurchmesser bzw. 40 mm Außendurchmesser. Beide Rohre sind an ihren beiden Enden so miteinander verbunden, dass sie eine gasdichte Hohlmanschette bilden. Es ist Xenon mit einem Druck von 200 mbar gefüllt. Die der Rohrachse zugewandte Wand der Hohlmanschette wird auf der Rohrachse zugewandten Seite mit einer Aluminiumschicht überzogen, welche die erste Elektrode bildet, und auf die der Rohrachse abgewandten Wand der Hohlmanschette werden auf der der Rohrachse abgewandten Seite sechs Streifen aus Silberfolie parallel zur Rohrachse aufgeklebt, welche die zweite Elektrode bilden. Die inneren Oberflächen der Hohlmanschette werden mit einer Leuchtstoffschicht beschichtet, die LaPO<sub>4</sub>:Nd als Leuchtstoff enthält.

Die Vorrichtung wird mit Wechselstrom mit Rechteckcharakteristik mit einer Amplitude von 6 kV und einer Frequenz von 25 kHz betrieben.

#### PATENTANSPRÜCHE

- 1. Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung mittels einer Exzimer-Entladung, ausgerüstet mit einem zumindest teilweise UV-transparenten Entladungsgefäß, dessen Entladungsraum mit einer Gasfüllung gefüllt ist, mit Mitteln zur Zündung und Aufrechterhaltung einer Exzimer-Entladung in dem Entladungsraum, mit einer Beschichtung, die einen Leuchtstoff, der ein Wirtsgitter und Neodym(III) als Aktivator umfasst, enthält, und mit Mitteln zur Zündung und Aufrechterhaltung der dielektrisch behinderten Entladung.
- 2. Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Leuchtstoff als Koaktivator Praseodym(III) enthält.
  - 3. Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- dass der Leuchtstoff ausgewählt ist aus der Gruppe (La<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>) PO<sub>4</sub>:Nd mit  $0 \le x \le 1$ ;  $(La_{1-x}Y_x) PO_4:Nd,Pr \text{ mit } 0 \le x \le 1; SrAl_{12}O_{19}:Nd; LaB_3O_6:Nd; LaMgB_5O_{10}:Nd;$ SrAl<sub>12</sub>O<sub>19</sub>:Nd,Pr; LaBO<sub>3</sub>O<sub>6</sub>:Nd,Pr; LaMgB<sub>5</sub>O<sub>10</sub>:Nd,Pr und GdPO<sub>4</sub>:Nd.
- 4. Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. 20 dass der Leuchtstoff eine Beschichtung, die ein Oxid, ausgewählt aus der Gruppe MgO,

ax G3 Nr. 485489 von 492417040170 an VERMITTLUNG (Seite 18 von 28) etreff: 28 Seite(n) empfangen

SiO2 und Al2O3, enthält, umfasst.

- 5. Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasfüllung ein Gas, ausgewählt aus der Gruppe Xenon, Krypton, Argon und Neon, enthält.
- Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasfüllung Xenon enthält.
- 7. Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroden aus einem Metall oder einer Legierung bestehen, das UV-C-Licht reflektiert.
- 8. Vorrichtung zur Erzeugung ultravioletter Strahlung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil des Entladungsgefäßes mit einer Beschichtung versehen ist, die als Reflektor für VUV- und/oder UV-C-Licht wirkt.
- 20 9. Verwendung der Vorrichtung gemäß Anspruch 1 für photolytische Prozesse.

1\9

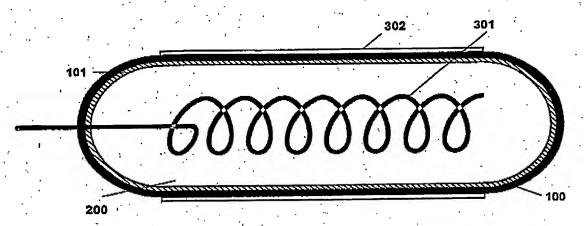


FIG. 1

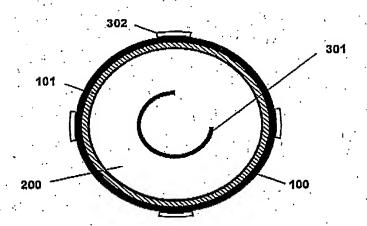


FIG. 2

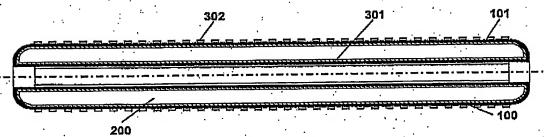


FIG. 3

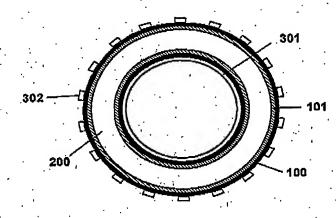


FIG. 4

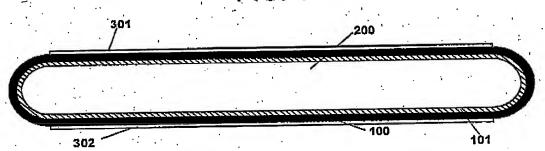


FIG. 5

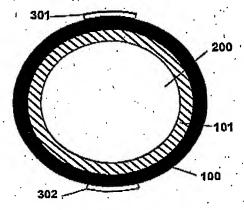


FIG. 6

CIP-DE AACHEN

NR.450 S.22

PHDE020051

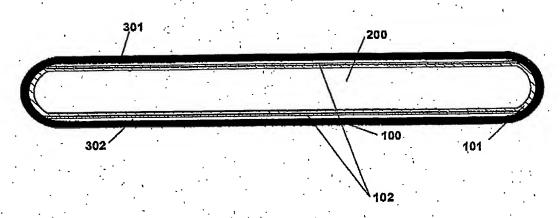


FIG. 7

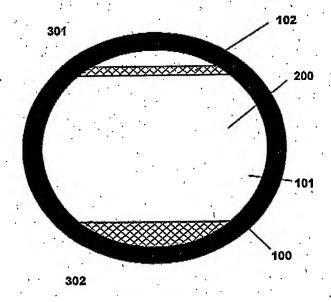


FIG. 8

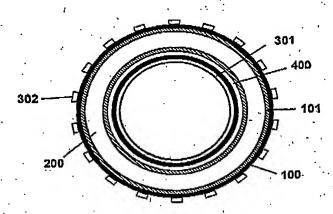


FIG. 9

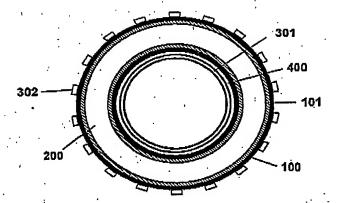
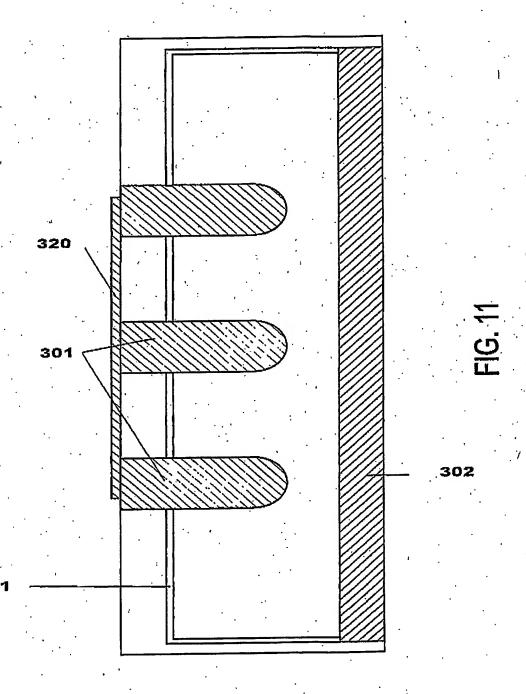


FIG. 10

CIP-DE AACHEN

NR. 450

5.24/28



6/9

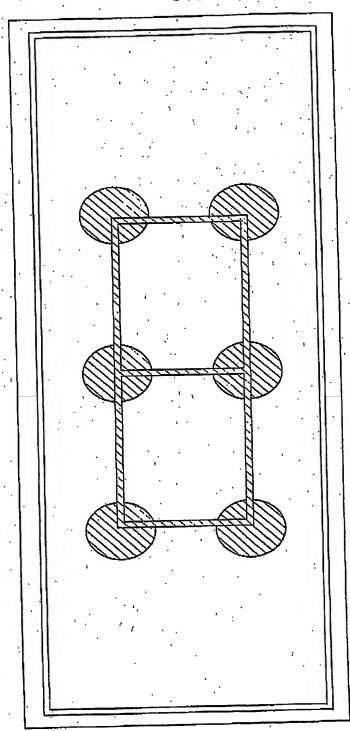


FIG. 12

4.MAR.2002 14:34

PHDE020051

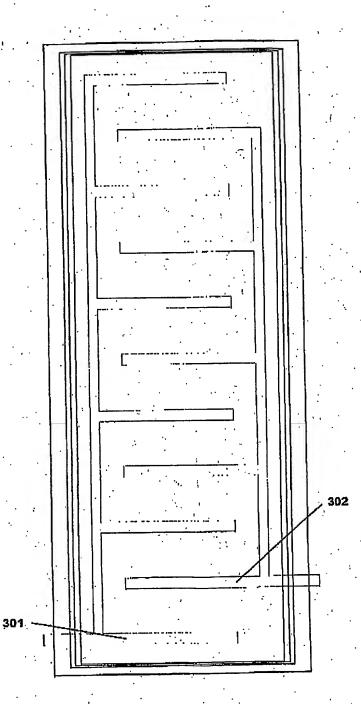
, i, 'C

CIP-DE AACHEN

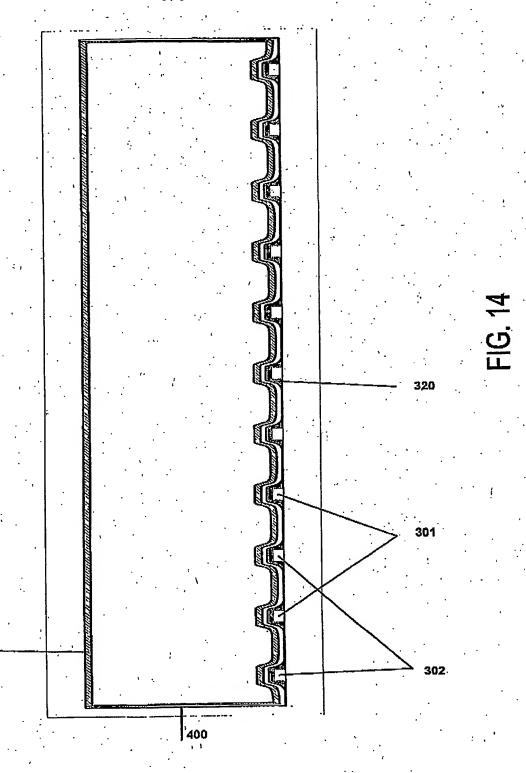
NR.450

5.26/28

7.19

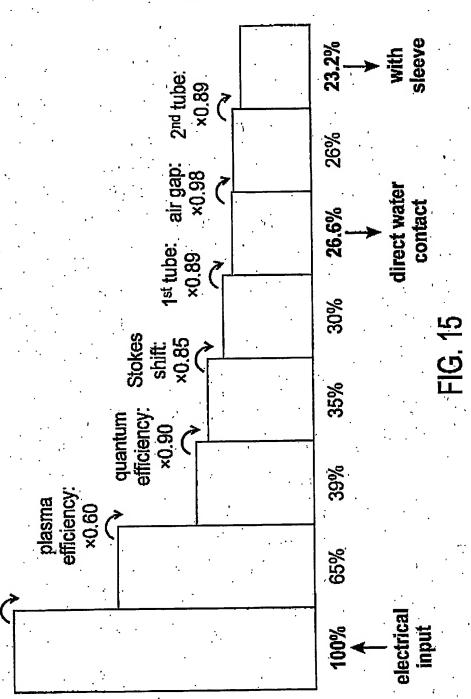


ax G3 Nr. 485489 von 492417040170 an VERMITTLUNG (Seite 26 von 28) m 04.03.02 14:21 Uhr - Status: Druckerfehler atreff: 28 Seite(n) empfangen



S.28/28





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

#### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.